

Milan Držík  
Ústav stavebnictva a architektúry SAV  
885 46 Bratislava

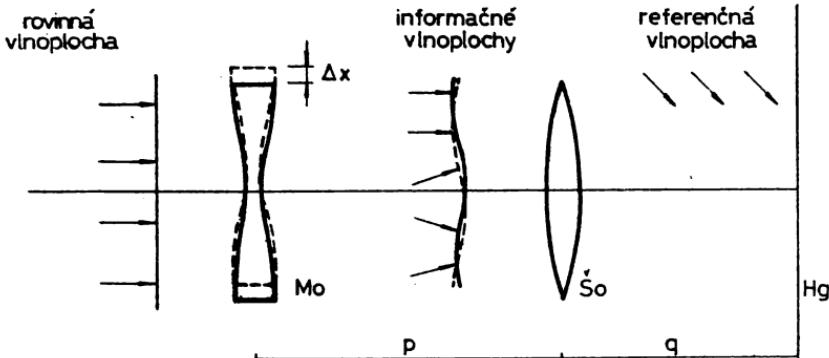
Holografický interferometer pre meranie  
pootočení roviných povrchov

Meranie pootočení roviných povrchov patrilo vždy medzi základné problémy v oblasti optických metód experimentálnej analýzy napäti. Tieto merania sú napríklad neoddelenou súčasťou vyšetrovania chýbaných dosiek, kde sklonov povrchu vzhľadom k súradnicovým osiam znamenajú derivácie priehybov. Pri modeloch zatažených rovinou napäťostou možno principiálne rovnako získať priebehy derivácií súčtov hlavných napäti.

Už v klasickej interferometrii bol známy tzv. zdvíhový interferometer, v ktorom sa využíval princíp interferencie dvoch vzájomne posunutých identických vlnoplôch po prechode zataženým modelom. Základným nedostatom tohto interferometra však bola nutnosť použitia náročných, veľmi kvalitných optických prvkov, presne planparalelných modelov a v nezmenšenej miere aj nutnosť dokonalej antivibračnej ochrany celého optického systému.

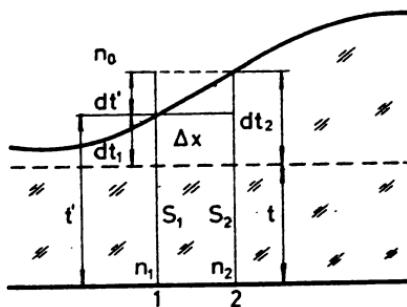
Väčšinu z týchto nedostatkov nemá navrhnutý interferometer, ktorý pracuje na základe princípu holografickej interferometrie. Využíva sa vlastnosti zobrazovacích hologramov - keď obraz objektu je premietnutý šošovkou do roviny holografického sáznamu - a dvojexpozičného postupu, pri ktorom obe expozície sa uskutočňujú so zataženým modelom a medzi expozíciami sa obraz objektu posunie. Pri rekonštrukcii takto získaného dvojexpozičného hologramu vzniká interferenčný obrazec, ktorého čiary zobrazujú krivky rovnakých pootočení povrchov modelu v smere súradnicovej osi paralelnej s priamkou vektora posunutia oboch obrazov.

Principiálny náčrt optickej sústavy holografického



Obr.1

zdvihového interferometra je na obr.1. Transparentný rovinatý modelom  $Mo$ , ktorý je deformovaný pôsobením zataženia, prechádza rovnobežný zväzok koherentných lúčov. Po prechode cez model sa táto vlnoplocha deformeuje fázovými zmenami spôsobenými jednak nerovnakou hrúbkou modelu, ako aj rozložením pola indexu lomu transparentného materiálu, ktoré je funkciou zatažovacieho napäťia. Šošovka  $Šo$  premieňa túto informačnú vlnoplochu do roviny hologramu  $Hg$ , kde sa interferenciou s referenčnou vlnoplochou vytvorí v záznamovom materiáli hologram. Pri prvej expozícii sa zaznamená vlnoplocha nesúca informáciu o deformovanom modeli v polohe 1. Pred druhou expozíciou sa model premiestní o malú vzdialenosť  $\Delta_x$  do polohy 2 a za modelom sa vytvorí vlnoplocha identická s vlnoplochou pri prvej expozícii, ale posunutá vzhľadom k prvej o  $\Delta_x$ . Jej záznamom pri druhej expozícii a po spracovaní hologramu vzniká pri rekonštrukcii dvojexpozičný interferogram. Interferenčný obrazec vyjadrite pomocou rozdielu optických dráh jednotlivých lúčov pri prvej a druhej expozícii. Na obr.2 je transparentný model, kde miesto 1 označuje vybraný lúč pri prvej expozícii a miesto 2 dráhu, ktorou sa bude tento lúč šíriť po posunutí modelu o  $\Delta_x$ . Obe optické dráhy môžeme vyjadriť pomocou indexu lomu materiálu modelu v mieste 1  $/n_1/$ , v mieste 2  $/n_2/$ , indexu lomu okolitého prostredia  $n_0$  a geometrických dráh  $t'$ ,  $dt'$ . Rozdiel optických



Obr.2

dráh dl potom bude

$$dl = n_2 / t' + dt' - / n_1 t' + n_0 dt' / \quad /1/$$

Pri rekonštrukcii hologramu tieto dva lúče môžu interferovať a vytvoria obrazec interferenčných čiar, ktorého maximá vznikajú v miestach, kde rozdiel optických dráh sa rovná celistvému násobku vlnových dĺžok svetla  $N\lambda$ .

Pre uvažované prípady modelov zaťažených rovinnou napäťosťou môžeme rozdiel  $dt'$  vyjadriť použitím vzťahu z pružnosti popisujúceho zmenu hrúbky modelu  $dt$  v závislosti od materiálových konštánt  $\nu$ ,  $E$  a súčtu hlavných napätií

$$dt = - \frac{\nu t}{E} / \sigma_x + \sigma_y / \quad /2/$$

Potom

$$dt' = dt_2 - dt_1 = - \frac{\nu t}{E} [ / \sigma_x + \sigma_y /_2 - / \sigma_x + \sigma_y /_1 ] \quad /3/$$

Podľa Maxwell-Neumanovho zákona, ktorý tu uvažujeme pre optické inertné materiály /napr. PMMA/, i rozdiel indexov lomu v miestach 1 a 2 je úmerný rozdielu súčtov hlavných napätií v oboch miestach

$$n_2 - n_1 = c_0 [ / \sigma_x + \sigma_y /_2 - / \sigma_x + \sigma_y /_1 ] \quad /4/$$

Dosadením /3/, /4/ do /1/ máme pre rozdiel optických dráh

$$N\lambda = c_0 \Delta S t' - \frac{\nu t}{E} / n_2 - n_0 / \Delta S \quad /5/$$

kde sme označili

$$\Delta S = / \sigma_x + \sigma_y /_2 - / \sigma_x + \sigma_y /_1 \quad /6/$$

V praxi môžeme položiť  $t' = t$  a  $n_0 = 1$ , čo je približne

index lomu vzduchu. Rovnica /5/ sa zjednoduší

$$N\lambda = \Delta St \left[ c_0 - \frac{\nu}{E} / n - 1 / \right] \quad /7/$$

Infinitezimálne platí

$$\frac{\partial S}{\partial x} = \frac{\Delta S}{\Delta x} \quad /8/$$

preto pomocou /7/ dostaneme vztah pre deriváciu funkcie súčtov hlavných napäťí  $S/x, y/$

$$\frac{\partial S}{\partial x} = \frac{\lambda}{[c_0 - \frac{\nu}{E} / n - 1 /] \Delta x} \cdot \frac{N}{t} = \frac{C}{\Delta x} \cdot \frac{N}{t} \quad /9/$$

Analogicky v smere osi y

$$\frac{\partial S}{\partial y} = \frac{C}{\Delta y} \cdot \frac{N}{t} \quad /10/$$

Konštantu interferenčnej citlivosti C meriame na modeloch so známym rozložením napäťosti pomocou izopachických čiar.

V prípade priečne ohýbaných dosiek , ktorých horná plocha je zrkadľovo odrážajúca, môžeme dráhový rozdiel lúčov v mieste 1 a 2 vyjadriť prostredníctvom priehybu dosky  $w$

$$dl = 2w \quad /11/$$

Pre deriváciu priehybov, ktorá súčasne znamená pootočenia povrchu k súradnicovým osiam, potom dostaneme

$$\frac{\partial w}{\partial x} = \frac{\lambda}{2} \cdot \frac{N}{\Delta x} \quad \text{resp.} \quad \frac{\partial w}{\partial y} = \frac{\lambda}{2} \cdot \frac{N}{\Delta y} \quad /12/$$

Optickú zostavu zdvihového interferometra sme realizovali ako bežné holografické schému pre záznam zobrazovacích hologramov s tým rozdielom, že v informačnej vetve nebola vložená matnica. Transparentné modely na prechod, rovnako ako modely dosiek zrkadľovo odrážajúce, boli ožarované rovnobežným sväzkom. Základný rozdiel od záznamu izopách /resp. priehybov/ spočíval v posunutí informačnej vlnoplochy medzi expozíciami, pričom model bol pri oboch expozíciiach v rovnakom zataženom stave. Pre posunutie celého modelu v zataženom stave sme používali prípravok jednoduchej konštrukcie vytvorený pomocou nevelkej frézovej platformy posúvanej pomocou tlačnej skrutky.

Praktické možnosti interferometra sme využili pre štúdium napäťostí v okolí trhlín a derivácií priehybov dosky.